

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成 25 年 11 月 14 日 (2013.11.14)

【公開番号】特開 2012-76932 (P2012-76932A)

【公開日】平成 24 年 4 月 19 日 (2012.4.19)

【年通号数】公開・登録公報 2012-016

【出願番号】特願 2010-220571 (P2010-220571)

【国際特許分類】

C 0 1 F 5/06 (2006.01)

G 0 2 B 1/11 (2006.01)

【 F I 】

C 0 1 F 5/06

G 0 2 B 1/10 A

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 9 月 27 日 (2013.9.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

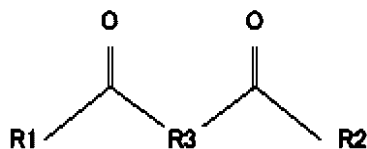
【特許請求の範囲】

【請求項 1】

(C F ₃ - X - C O O) ₂ M g (式中、X は単結合、フッ素原子で置換されても良い - C H ₂ - を表す) で表されるマグネシウム化合物と、
前記マグネシウム化合物 1 m o l に対し、0 . 1 m o l 以上 5 m o l 以下の範囲で、
下記一般式 (1) で表される化合物と、を含むことを特徴とする光学膜製造用塗布液。

【化 1】

一般式 (1)



(式中、R 1、R 2 は水素原子、アルキル基あるいはアルコキシ基、R 3 は - O - あるいは - C H ₂ - を表す。)

【請求項 2】

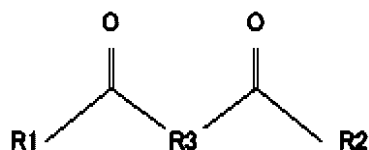
前記一般式 (1) で表される化合物が無水酢酸であることを特徴とする請求項 1 に記載の光学膜製造用塗布液。

【請求項 3】

少なくとも (C F ₃ - X - C O O) ₂ M g (式中、X は単結合、フッ素原子で置換されても良い - C H ₂ - を表す。) で表されるマグネシウム化合物および下記一般式 (1) で表される化合物を混合した後に溶媒で濃度を調整する工程を有することを特徴とする光学膜製造用塗布液の製造方法。

【化 2】

一般式 (1)



(式中、R1、R2は水素原子あるいはアルキル基、R3は-O-あるいは-CH₂-を表す。)

【請求項4】

請求項1または2に記載の光学膜製造用塗布液を基材に塗布する工程、前記光学膜製造用塗布液を塗布した基材を加熱する工程を有することを特徴とする光学膜の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0018】

上記の課題を解決する光学膜製造用塗布液は、(CF₃-X-COO)₂Mg(式中、Xは単結合、フッ素原子で置換されても良い-CH₂-を表す)で表されるマグネシウム化合物と、

前記マグネシウム化合物1molに対し、0.1mol以上5mol以下の範囲で、下記一般式(1)で表される化合物と、を含むことを特徴とする。